マスクレス露光装置

メーカー	株式会社ナノシステムソリューションズ
型式	DL-1000
概要	CADで作成した微小パターンデータを、フォトマスクなしで直接基板上のフォトレジストに転写できる装置です。 通常の工程ではフォトマスクと呼ばれる光の形を決めるプレートが必要ですが、本装置には不要なので短時間で大量の微細構造を作製できます。 半導体または金属材料等に微細な加工を施すことができるため、開発・試作向けの直接描画装置またはフォトマスクの製造装置等として利用することができます。
仕様	露光方式：スキャン露光方式 光源・波長：LD・405nm 最小画素：1μm ワークサイズ：100×100mm 重ね合わせ精度：±1μm以内 露光ピクセル数1024×768 最高処理能力：50m㎡/min以上 位置決め精度：±0.1μm オートフォーカス：精度±1μm以内 対応CADフォーマット：DXF、GDS II
オプション	グレースケールデータ作成ソフト
備品	ドラフト、イオン交換水(Mili-DI)、スピンコーター、 光学顕微鏡(SZX16、 OLIMPUS)、小型エアコンプレッサー、 ホットプレート
利用条件	基板、試薬は利用者様がご準備ください。
設置場所	地域産学連携研究センター　装置室A
利用料	3,080円/時間（税込）
連絡先	予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。 044-934-7250（内線7250） cii●mics.meiji.ac.jp （●の部分を@に置き換えてお送りください）